

Macchina Per Forno Tubolare Rotante Inclinato Per La Deposizione Chimica Potenziata Al Plasma (Pecvd)

Numero articolo: KT-PE16



introduzione

Vi presentiamo il nostro forno PECVD rotativo inclinato per la deposizione precisa di film sottili. La sorgente si abbina automaticamente, il controllo della temperatura programmabile PID e il controllo del flussimetro di massa MFC ad alta precisione. Funzioni di sicurezza integrate per la massima tranquillità.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello di forno	PE-1600-60
Temperatura massima	1600°C
Temperatura di lavoro costante	1550°C
Materiale del tubo del forno	Tubo Al2O3 di elevata purezza
Diametro del tubo del forno	60 mm
Lunghezza della zona di riscaldamento	2x300mm
Materiale della camera	Fibra di allumina del Giappone
Elemento di riscaldamento	Disiliciuro di molibdeno
Velocità di riscaldamento	0-10°C/min
Coppia termica	Tipo B
Regolatore di temperatura	Controllore PID digitale/controllore PID touch screen
Precisione del controllo della temperatura	±1°C
Unità al plasma RF	
Potenza di uscita	5 -500W regolabile con una stabilità di ± 1%
Frequenza RF	13,56 MHz ±0,005% di stabilità
Potenza di riflessione	350W max.
Corrispondenza	Automatico
Rumore	
Raffreddamento	Raffreddamento ad aria.
Unità di controllo precisa del gas	
Misuratore di portata	Misuratore di portata massica MFC
Canali del gas	4 canali
Portata	MFC1: 0-5SCCM O2 MFC2: 0-20SCMCH4 MFC3: 0-100 SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2

Linearità	±0,5% F.S.
Ripetibilità	±0,2% F.S.
Linea di tubi e valvola	Acciaio inossidabile
Pressione massima di esercizio	0,45MPa
Controllore del flussometro	Controllore digitale a manopola/controller a schermo tattile
Unità di vuoto standard (opzionale)	
Pompa per vuoto	Pompa per vuoto rotativa a palette
Portata della pompa	4L/S
Porta di aspirazione del vuoto	KF25
Vacuometro	Vacuometro Pirani/Resistenza al silicone
Pressione nominale del vuoto	10Pa
Unità per alto vuoto (opzionale)	
Pompa per vuoto	Pompa rotativa a palette+pompa molecolare
Portata della pompa	4L/S+110L/S
Porta di aspirazione del vuoto	KF25
Vacuometro	Vacuometro composto
Pressione nominale del vuoto	6x10 ⁻⁵ Pa
Le specifiche e le configurazioni di cui sopra possono essere personalizzate	

No.	Descrizione	Quantità
1	Forno	1
2	Tubo di quarzo	1
3	Flangia per il vuoto	2
4	Blocco termico del tubo	2
5	Gancio del blocco termico a tubo	1
6	Guanto resistente al calore	1
7	Sorgente di plasma RF	1
8	Controllo preciso del gas	1
9	Unità per il vuoto	1
10	Manuale operativo	1